

## 最近の化学工学講習会 68

—塗布・乾燥技術の基礎とものづくり:新素材の利用と次世代デバイスへの展開—  
報告書

山村方人(九州工業大学)(文責)

2020年1月20～21日に早稲田大学西早稲田キャンパスにて最近の化学工学講習会68を化学工学会関東支部主催・化学工学会材料・界面部会 塗布技術分科会共催で実施した。詳細は下記の通りである。

日時	1月20日 9:25～18:15 (講演11件) 1月21日 10:00～17:00 (講演8件)
会場	早稲田大学西早稲田キャンパス 55号館 第2会議室
聴講者数	90名(産86名,学4名)
講演	『種々の塗布方式の歴史と変遷』宮本 公明 氏(元富士フイルム株式会社) 『塗布流動の基礎』津田 武明 氏(ダウ・東レ株式会社) 『レオロジーの基礎』菰田 悦之 氏(神戸大学) 『スラリー分散・凝集制御』森 隆昌 氏(法政大学) 『流れと表面張力』本間 俊司 氏(埼玉大学) 『スロットダイ塗布』笹野 祐史 氏(株式会社ヒラノテクシード) 『グラビア塗布の概要およびプロセス管理』三浦 秀宣 氏(富士機械工業株式会社) 『電子線の産業利用』武井 太郎 氏(岩崎電気株式会社) 『赤外線を用いた塗布膜乾燥プロセスの特徴と効果』近藤 良夫 氏(日本ガイシ株式会社) 『最近の学術動向と計測評価手法の進展』山村 方人 氏(九州工業大学) 『印刷型有機集積回路とIoTセンサ応用』時任 静士 氏(山形大学)

<p>『ウェアブル・デバイスの印刷形成と材料に求められる課題』沼倉 研史 氏 (DKNリサーチ)</p> <p>『微細印刷のパターニング原理と応用プロセス』日下 靖之 氏 (産業技術総合研究所)</p> <p>『二次電池、燃料電池の電極スラリーモデルのレオロジー』中村 浩 氏 (株式会社豊田 中央研究所)</p> <p>『クレーストソリューションキャストリングによる高付加価値製品開発』蛭名 武雄 氏 (産業技術総合研究所)</p> <p>『セルロースナノファイバーの構造・基礎特性と塗布・乾燥分野への応用と課題』磯貝 明 氏 (東京大学)</p> <p>『塗布乾燥シミュレーション』富塚 孝之 氏 (株式会社アドバンスト・ソフト)</p> <p>『ナノ粒子の表面設計による液中分散制御』飯島 志行 氏 (横浜国立大学)</p> <p>『乾燥に伴う界面変形 :液液および固液界面での物質移動』稲澤 晋 氏 (東京農工大学)</p>
--

以上